

دستگاه حرارت دهی سریع در اتمسفر کنترل شده

Rapid Thermal Processing



کاربردها

- رسوبدهی لایه نازک
- ایجاد لایه اکسیدی بر روی سطح
- آنالیز ساختاری لایه نازک در دمای بالا
- آنالیز فازی مواد
- بررسی نقطه ذوب مواد
- سلنیوم/ سولفور کردن لایه‌های نازک کالکوژنی

برخی ویژگی‌ها

- استفاده آسان برای عملیات حرارتی در شرایط خلاء یا دمیدن گاز مورد نظر
- در فشار اتمسفر
- بدون نیاز به سیستم خنک کن اضافی
- حداقل بودن تشعشع گرمایی در حین استفاده
- سیستم کوچک و قابل حمل و استفاده
- دقت اندازه گیری دما با قرار دادن سنسور دما در محل نگهداری نمونه
- امکان استفاده به عنوان کوره تا دمای ۶۰۰ درجه‌ی سانتی گراد

مشخصات:

	Unit	Specification
Max sample size	mm	12 x 12mm
Maximum rising speed	°c/min	300
Maximum Cooling speed	°c/min	60
Max temp	°c	700
Temp accuracy	°c	+/-5
Lamp power	W	1000
Size	Cm	40 x 20 x20
Weight	Kg	15
Voltage rate	V	220V, single phase (25A) or 3 phase